HIGH FREQUENCY SEMICONDUCTOR DEVICE

Publication number: JP2002299947

Publication date:

2002-10-11

Inventor:

AOKI YOSHIO; MIMINO YUTAKA; BABA OSAMU;

GOTO MUNEHARU

Applicant:

FUJITSU QUANTUM DEVICES LTD

Classification:

- international:

H01L21/822; H01L27/04; H01Q1/38; H01Q9/04; H01Q13/08; H01Q23/00; H01L21/70; H01L27/04; H01Q1/38; H01Q9/04; H01Q13/08; H01Q23/00; (IPC1-7): H01Q13/08; H01L21/822; H01L27/04; H01Q23/00

- european:

H01Q1/38; H01Q9/04B5; H01Q23/00

Application number: JP20010099961 20010330 Priority number(s): JP20010099961 20010330

Also published as:

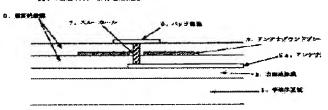
US6825809 (B2) US2002140609 (A

Report a data error he

Abstract of JP2002299947

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the influence of an antenna characteristic by an antenna line connected to a patch electrode of a patch antenna mounted on an MMIC. SOLUTION: A through hole is formed in an antenna ground plane under the patch electrode between inter-layer insulation layers, the antenna line is provided on the side opposite from the patch electrode across the antenna ground plane, and the patch electrode is connected to the antenna line by a conductor that passes through the through hole.

N8 0单分 AAIC 排行 在新町網



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ŧ

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-299947 (P2002-299947A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51) Int.Cl.7			
==	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H01Q 13/08		HO10 10/00) - 11-r (多考)
H01L 27/04		H 0 1 Q 13/08	5F038
21/822		23/00	5 J O 2 1
H01Q 23/00		H01L 27/04	D 5J045

		審査請求 有 請求項の数16 OL (全 8 頁)
(21)出願番号	特願2001-99961(P2001-99961)	(71)出願人 000154325
(22)出願日	平成13年3月30日(2001.3.30)	富士通カンタムデバイス株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町大字紙遮阿原1000番 地
		(72)発明者 青木 芳雄
		山梨県中巨摩郡昭和町大字紙漉阿原1000番 地 富士通カンタムデバイス株式会社内
		(72)発明者 耳野 裕
		山梨県中巨摩郡昭和町大字紙渡阿原1000番 地 富士通カンタムデバイス株式会社内
		(74)代理人 100072590 弁理士 井桁 貞一
		具数百分钟人

最終頁に続く

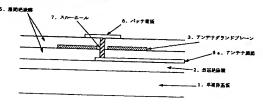
(54) 【発明の名称】 高周波半導体装置

(57)【要約】

【課題】 MMICに搭載するパッチアンテナのパッチ 電極に接続するアンテナ線路によるアンテナ特性の影響 を排除する。

【解決手段】 パッチ電極の下に層間絶縁膜を介して設けられたアンテナグランドプレーンにスルーホールを形成し、アンテナグランドプレーンを間にして、パッチ電極と反対側にアンテナ線路を設け、パッチ電極とアンテナ線路とを、このスルーホールを貫通する導体で接続する。

図3の総分A-A'における新西図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板上に設けられ、接地電位と接 続されるアンテナグランドプレーンと、

前記アンテナグランドプレーン上に層間絶縁膜を介して 設けられたパッチ電極と、

前記アンテナグランドプレーンの下部に設けられ、当該 アンテナグランドプレーンを通過するスルーホールによ って前記パッチ電極と接続されるアンテナ接続部とを備 えることを特徴とする高周波半導体装置。

【請求項2】 前記アンテナ接続部はパターンニングさ れた導体よりなるアンテナ線路であることを特徴とする 請求項1記載の高周波半導体装置。

前記アンテナ接続部は、前記半導体基板 に設けられた活性領域であることを特徴とする請求項1 【請求項3】 記載の高周波半導体装置。

前記半導体基板上には接地電位との間で 高周波伝送路を構成する線路導体を有することを特徴と 【請求項4】 する請求項1記載の高周波半導体装置。

前記線路導体は、前記半導体基板上に設 けられ接地電位に接続される接地プレートとの間で高周 【請求項5】 波伝送路を構成することを特徴とする請求項4記載の高 周波半導体装置。

【請求項6】 前記接地プレートは前記アンテナ接続部 であるアンテナ線路の下に設けられ、当該アンテナ線路 は前記接地プレートとの間で高周波伝送路を構成するこ とを特徴とする請求項5記載の高周波半導体装置。

【請求項7】 前記アンテナグランドプレーン上には層 間絶縁膜を介して線路導体が設けられ、当該線路導体は 前記アンテナグランドプレーンとの間で高周波導波路を 構成することを特徴とする請求項1記載の高周波半導体

【請求項8】 前記半導体基板上には前記アンテナグラ 装置。 ンドプレーンとは別に接地電位に接続される接地プレー トが設けられ、当該接地プレート上には層間絶縁膜を介 して設けられた線路導体が設けられて当該線路導体は前 記接地プレートとの間で高周波伝送路を構成することを 特徴とする請求項7記載の高周波半導体装置。

前記アンテナグランドプレーンは前記半 導体基板の実質的全面に設けられ、全ての前記線路導体 【請求項9】 は当該アンテナグランドプレーンとの間で高周波伝送路 を構成することを特徴とする請求項7記載の高周波半導

【請求項10】 前記アンテナグランドプレーンの下に パッシブデバイスが設けられることを特徴とする請求項 1 記載の高周波半導体装置。

【請求項11】 前記パッシブデバイスは、線路導体, キャパシタ素子,インダクタンス素子,抵抗素子のいず れかであることを特徴とする請求項10記載の高周波半 導体装置。

前記層間絶縁膜は樹脂絶縁材料である 50 【請求項12】

ことを特徴とする請求項1記載の髙周波半導体装置。

【請求項13】 前記樹脂絶縁材料は、ポリイミドある いはベンゾシクロブテンであることを特徴とする請求項 1 2 記載の高周波半導体装置。

2

【請求項14】 前記パッチ電極は矩形あるいは円形で あることを特徴とする請求項1記載の高周波半導体装 置。

【請求項15】 前記パッチ電極あるいはアンテナグラ ンドプレーンは、良導体であることを特徴とする請求項 1 記載の高周波半導体装置。

【請求項16】 前記良導体は金あるいは超伝導体であ ることを特徴とする請求項15記載の高周波半導体装

【発明の詳細な説明】

20

[0001] 【発明の属する技術分野】本発明は高周波半導体装置、 特にMMIC (Monolithic Microwave Integrated Circui t) に搭載されるパッチアンテナに関するものである。

【従来の技術】HEMTやHBTに代表される高速半導体デバ イスを利用したMMICには、外部と信号の送受信を行うた めにアンテナが搭載される場合がある。

【0003】MMICとの集積化が容易なアンテナとして は、いわゆるパッチアンテナが知られている。

【0004】図1は、従来のパッチアンテナを説明する 透過平面図、図2はその線分A-A'における断面図であ

【0005】従来のパッチアンテナ100は、半導体基 板1上にその表面を保護する表面絶縁膜2が設けられ、 その上に接地電位に接続されるアンテナグランドプレー ン3上に層間絶縁膜5を介して設けられたパッチ電極6 および、パッチ電極6〜電力の供給を行う(または、パ ッチ電極6から電力を取り出す) アンテナ線路6 a が設 けられた構造を有している。

【発明が解決しようとする課題】図1,2で説明した従 来のパッチアンテナは、平面的なメタライズパターンで 形成できるため、MMICに集積化するのは容易である。

【0007】ところで、アンテナの給電部に相当する部 分はパッチ電極6であり、その外形はアンテナの特性を 決める主要な部分となる。しかし、パッチ電極6にはア ンテナ線路 6 aを接続する必要があり、その結果、実効 的なパッチ電極はパッチ電極6とアンテナ線路6aとの 合成された形状を有することになる。すなわち、従来の パッチアンテナはアンテナ線路6aの形状を含んでいる ため、放射パターンなどのアンテナ特性がパッチ電極 6 の設計だけで得られる理想値とは異なっていた。

【0008】本発明は、アンテナ線路6aのパッチ電極 6 への影響を防止することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】図3は本発明の原理を説 明する図であり、図4はその線分A-A'における断面図で ある。

【0010】図からも明らかなように、本発明はアンテ ナ接続部であるアンテナ線路 6 aをアンテナグランドプ レーン3の下部に設け、スルーホール7を介してパッチ 電極6の裏面に接続するものである。

【0011】本発明によれば、表面にアンテナ線路 6a が設けられないため、パッチ電極6の外形が変化せず、 したがってアンテナ特性が変化することがない。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を説明す

【0013】図5は本発明を採用したMMICの第1実施例 を説明する透過平面図である。図6は図5の線分A-A'に おける断面図である。

【0014】本実施例ではGaAsからなる化合物半導 体基板 1 を使用し、FET などの能動デバイス(図示せ ず)を形成した後、その表面に窒化シリコンからなる表 面絶縁膜2が設けられている。そして、表面絶縁膜2上 20 に図示しない配線あるいはスルーホールによって接地電 位に接続される金 (Au)からなる接地プレート8が設け られ、その上に層間絶縁膜5を介してアンテナ線路6 a、接地電位に接続されるアンテナグランドプレーン3 および、パッチ電極6が設けられる。ここで、アンテナ 線路 6 aは接地プレート 8 との間で高周波伝送路を構成 しており、また、パッチアンテナ100以外の領域には 接地プレート8との間で高周波伝送路を構成する線路導 体9が設けられる。なお、アンテナ線路6aとパッチ電 極6との間は、アンテナグランドプレーン3に設けられ 30 た抜きパターンを通過するスルーホール7によって接続 され、その内部がスルーホール導体 7 aによって導通さ れている。

【0015】ここで、各層間絶縁膜5はポリイミドやベ ンゾシクロブテン(BCB)によって構成されており、 アンテナ線路 6 a、アンテナグランドプレーン3、パッ チ電極 6 および線路導体 9 は、スパッタリングや蒸着な どによって被着された金(Au)が使用され、イオンミリン グやリフトオフによってパターンニングされたものであ る。また、スルーホール導体 7 aはメッキなどによって 金(Au)を充填して形成される。

【0016】本実施例によれば、アンテナ線路6aとパ ッチ電極6との接続が同じ表面上でなされないため、ア ンテナ線路 6 aがパッチ電極 6 の外形に影響することが なくなる。

【0017】図7は本発明の第2実施例を説明する透過 平面図である。図8は図7の線分A-A'における断面図で ある。

【0018】本実施例では、接地電位に接続されるアン

のない領域にまでその面積を広くし、これを接地プレー トとして機能させるものである。すなわち、アンテナ機 能に実質的に影響のない領域のアンテナグランドプレー ン3上に層間絶縁膜5を介して線路導体9を配置すれ ば、その線路導体9はアンテナグランドプレーン3との 間で高周波伝送路を構成することが可能になるのであ る。

【0019】図9は本発明の第3実施例を説明する透過 平面図である。図10は図9の線分A-A'における断面図 10 である。

【0020】本実施例では、アンテナグランドプレーン 3の下部に線路導体9が設けられている。アンテナグラ ンドプレーン3は接地電位に接続されるものであるた め、パッチアンテナ100の下面はアンテナ特性に特段 の影響を及ぼすことはなく、したがって、その下部に線 路導体9を設けることで、より一層の集積化を図ること が出来る。なお、アンテナグランドプレーン3の下に設 けられるものは、線路導体以外のパッシブデバイス (キ ャパシタ素子、インダクタンス素子、抵抗素子) であっ ても良い。

【0021】図11は本発明の第4実施例を説明する透 過平面図である。図12は図11の線分A-A'における断 面図である。

【0022】本実施例では、アンテナグランドプレーン 3がMMIC全体の接地プレートとして機能している。すな わち、アンテナグランドプレーン3がアンテナ機能とし て実質的に影響のない領域に線路導体9を設けること で、アンテナグランドプレーン3を高周波伝送路の接地 プレートとして機能させるのである。本実施例では、ア ンテナ線路を使用せず、半導体基板1に設けられた活性 領域1aをアンテナ接続部としている。

【0023】本実施例によれば、アンテナグランドプレ ーン3が接地プレートと共通であるので、接地プレート の形成工程が省略できる。

【0024】本発明は、以上説明した実施例に限らず、 種々に変更が可能である。たとえば、パッチ電極として 矩形のものを示したが、パッケージのような外囲器の形 状、給電位置、複数給電等の態様に応じて、円形のよう な他の形状とした場合に対しても本発明を適用できる。 40 また、パッチ電極やアンテナグランドプレーンは金(Au) 以外の導体を使用することもでき、たとえば超伝導材料 を使用することも可能である。

【0025】また、本発明によれば、以上の説明におけ るような一つのパッチアンテナに限らず、複数のパッチ アンテナを並べたパッチアンテナアレイなどを実現する ことも可能である。

[0026]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、パ ッチ電極の外形に影響を与えずにアンテナ線路が接続で テナグランドプレーン3をアンテナ機能に実質的に影響 50 きるので、特性の良好なアンテナを備えた高周波半導体

5

装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 従来のパッチアンテナを説明する透過平面図
- 【図2】 図1の線分A-A'における断面図
- 【図3】 本発明の原理を説明する透過平面図
- 【図4】 図3の線分A-A'における断面図
- 【図5】 本発明を採用したMMICの第1実施例を説明す

る透過平面図

- 【図6】 図5の線分A-A'における断面図
- 【図7】 本発明の第2実施例を説明する透過平面図
- 【図8】 図7の線分A-A'における断面図
- 【図9】 本発明の第3実施例を説明する透過平面図
- 【図10】 図9の線分A-A'における断面図
- 【図11】 本発明の第4実施例を説明する透過平面図

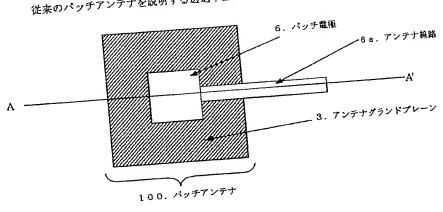
【図12】 図11の線分A-A'における断面図 【符号の説明】

6

- 半導体基板
- 活性領域 1 a
- 表面絶縁膜 2
- アンテナグランドプレーン 3
- 層間絶縁膜 5
- パッチ電極 6
- アンテナ線路 6 a
- スルーホール 7
- スルーホール導体 7 a
- 接地プレート 8
- 線路導体
- 100 パッチアンテナ

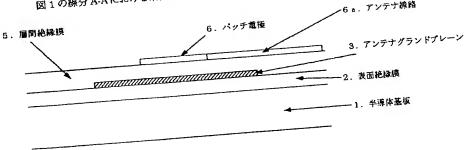
【図1】

従来のパッチアンテナを説明する透過平面図



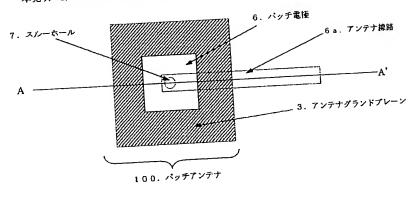
[図2]

図1の線分A-A'における断面図



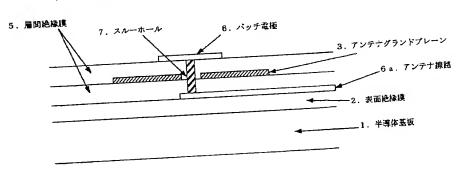
[図3]

本発明の原理を説明する透過平面図



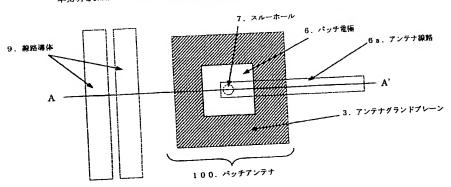
[図4]

図 3 の線分 A-A'における断面図



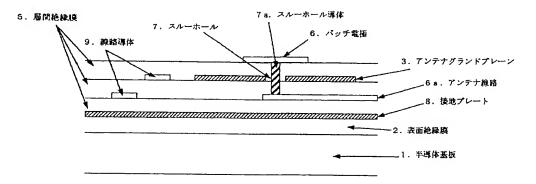
【図5】

本発明を採用した MMIC の第 1 実施例を説明する透過平面図



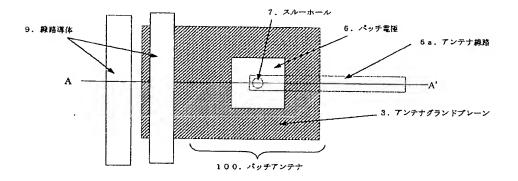
[図6]

図5の線分A-A'における断面図



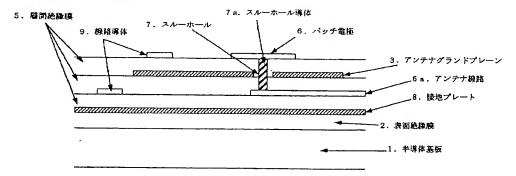
【図7】

本発明の第2実施例を説明する透過平面図



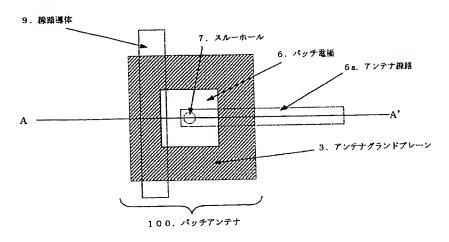
【図8】

図7の線分A-A'における断面図



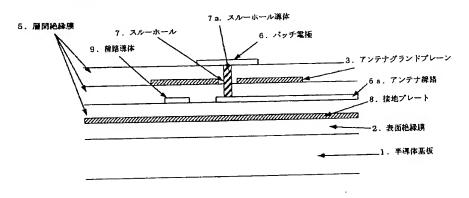
【図9】

本発明の第3実施例を説明する透過平面図



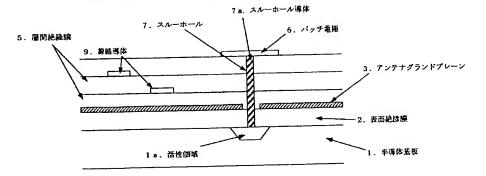
[図10]

図9の線分 A-A'における断面図

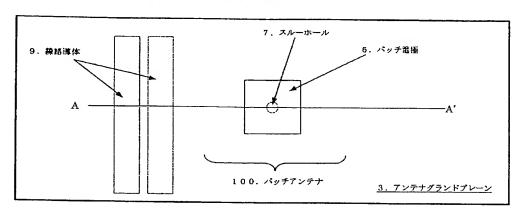


【図12】

図11の線分 A-A'における断面図



【図11】本発明の第4実施例を説明する透過平面図



フロントページの続き

(72) 発明者 馬場 修

山梨県中巨摩郡昭和町大字紙漉阿原1000番 地 富士通カンタムデバイス株式会社内

(72)発明者 後藤 宗春

山梨県中巨摩郡昭和町大字紙漉阿原1000番 地 富士通カンタムデバイス株式会社内 Fターム(参考) 5F038 AZ01 BH10 CD04 CD18 DF02

EZ02 EZ20

5J021 AA01 AB06 CA06 FA26 HA05

HA10 JA07

5J045 AA01 AA27 DA10 EA08 HA06

MAO4 NAO1